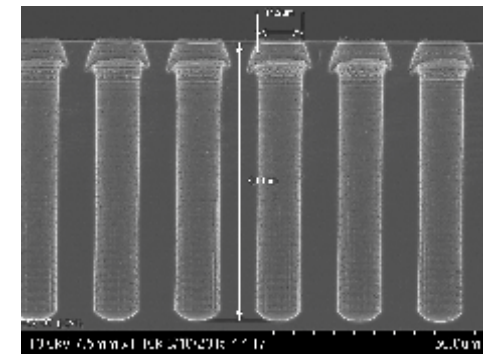


МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ГЛУБОКОГО АНИЗОТРОПНОГО ТРАВЛЕНИЯ

МВУ ТМ ПЛАЗМА 06

Назначение: Плазмохимическое глубокое селективное травление кремниевых пластин.



Особенности:

- Индивидуальная обработка подложек в одном технологическом цикле: до \varnothing 150 мм – 1 шт.;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ в диапазоне 30 – 200 Вт;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ ICP источника плазмы в диапазоне 400 – 600 Вт;
- Рабочие газы: Ar, SF₆, C₄F₈;
- Безмасляная система откачки;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 5,5 кВт.

